

X-RAY IMAGING OPTICS

X線結像光学ニューズレター

No. 52 2020 年 12 月発行

最近の超軽量 MEMS X 線望遠鏡の開発状況

東京都立大 江副祐一郎 宇宙科学研究所 石川久美 国立天文台 満田和久

はじめに

半導体の微細加工技術を用いた微細穴内壁でのX線 反射への利用が、特に次世代の宇宙X線観測衛星を 対象として大きく進展している[1]。これまで宇宙観 測用のX線全反射鏡は、ガラス基板の表面研摩、電析



図1 宇宙 X 線望遠鏡の性能比較。縦軸は 1 keV で 1000 cm² の有効面積を実現するために必要な 重量。横軸は角度分解能。星、菱形、小丸が従来 方式とそれぞれが用いられた宇宙 X 線観測衛星の 名前に対応する。丸が微細穴 X 線光学系の期待さ れる性能[3]。 による母型のレプリカ鏡、アルミフォイルの熱成型 のいずれかで製作されてきたが、微細穴X線光学系 では原理的にこれらを上回る軽量性を、角度分解能 を保持したまま実現できる。図1に従来の方式との比 較を示す。

微細穴X線光学系では従来のX線鏡のサイズをC 倍縮小化することで、重量をC³倍に軽量化する。一 方で有効面積を保つためには、サイズの縮小分を補 うため、C²倍の鏡枚数を必要とするが、望遠鏡全体 の重量としてはC⁻³⁺²=C⁻¹倍で重量が減ることにな る。すなわち縮小すればするほど軽量となるのだが、 縮小しすぎると穴幅とX線波長によって決まる回折 によって像がぼける。例えば 1 keV で 20 μm の穴 幅とした場合、13 秒角が限界となるが、これは従来 のレプリカ方式の鏡に匹敵する値であり、宇宙X線 観測に十分に利用可能な性能である。

これまでに微細穴X線光学系としては Si 基板の 表面に井桁構造を作り、基板を積層させた SPO (Silicon Pore Optics)方式[2]や、ガラスファイバー 内壁での全反射を用いた MCP (Micro Channel Plate)方式[1]がある。しかし、前者は穴幅が積層す る基板の厚みによって決まり 100 µm 程度が限界 となるため、フォイル方式を越える超軽量性を実現 することは難しい。後者は10 µm オーダーの微細穴



図2 我々の MEMS X 線望遠鏡のプロセスフロー。口径は使用する Si 基板のサイズで決まり、焦点距離 は高温塑性変形の曲率半径で決まる。パラメータは現在製作中の Wolter I 型望遠鏡の典型的な値。1 回 反射型集光系(口径 4 inch と 12 inch)と Wolter I 型望遠鏡(口径 4 inch)の試作品も示した。

が可能だが、穴を形成する際のエッチング工程やフ ァイバーを束ねる際の精度によって鏡面精度が制限 される問題がある。本稿ではこれらの問題点を克服 する MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)、 いわゆるマイクロマシンの製造技術を用いた、我々 独自の微細穴光学系の開発状況について述べる。さ らにその将来衛星ミッションへの応用と、派生的に 生まれた新たなX線光学系についても報告する。

我々の手法

微細穴X線光学系では穴を小さくするほど軽量とな るが、鏡面となる細かい穴の側壁の研摩研削は困難 となる。我々はフォイル方式を越える超軽量性と良 好な結像性能を両立する新手法として MEMS の 微細加工技術を応用した手法を開発してきた。図2に 示すように 300-450 µm 厚程度の比較的薄い Si 基板にガスを使った反応性ドライエッチングによっ て垂直な曲面穴を形成する。深掘りには DRIE (Deep Reactive Ion Etching)と呼ばれるエッチング ガスと保護ガスを交互に導入する技術を用いる。こ れにより20 µm程度の穴幅の微細穴の貫通ができる。 しかしエッチング後の側壁の表面粗さは、スキャロ ップと呼ばれるでこぼこによって 10 nm rms を切 ることは難しいため、平滑化プロセスが必要となる。

そこで高温アニールと呼ばれる Si 基板を1100-1200°C程度の高温下 (Si 融点 1410°C)に置き、清浄 化ガスを絶えず流すことで、表面原子の拡散をうな がして 1 nm rms を切る平滑な鏡面に仕上げる。さ らに前段の長時間エッチングでどうしても避け得な い端部のバリ(高さ 1 µm 以下程度)を研削と化学機 械研摩によって表裏面からそれぞれ50 µm程度削り 取る。この際には微細穴を壊さないように穴に保護 材を封入し、処理後に薬液で取り除く。

ここまでで側壁はX線全反射鏡として完成してい るが基板自体は平面のため、宇宙X線の集光結像に は使えない。そこでSi 高温塑性変形という日本発祥 の高温プレス変形[4]によって、Si の結晶面の転位 を利用した球面変形を行う。都立大では日本に数台 しかないこのSi 高温塑性変形装置を発案者の東北 大 中嶋先生から譲り受けて使用している。曲率半径 は変形時に用いるプレス治具で制御できるが、変形 後のスプリングバックによって形状の戻りや、穴同 士の間の梁の間隔や太さによって変形精度が影響を 受けるので注意が必要である。

っぎに鏡面となる側壁に反射率を上げるために Ir や Pt などの重金属を膜付けする。高アスペクト の穴内部になるため、スパッタや電析では難しく、 原子層堆積法(ALD, Atomic Layer Deposition)とい う複数の気相の化学反応の連続的な使用による膜付 け方法を採用している。Pt などはSi には直接、膜 付けできないあるいは非常に剥がれやすくなるため、 バッファー層としてAl₂O₃などが必要となる[5]。nm order での一様な膜付けが可能だが、表面粗さはア ニール後から若干劣化して 1-2 nm rms となる。<2 keV の軟X線での用途には使用可能であるが、今後 の改善が必要な課題点である。

最後に異なる曲率半径で曲げた2枚の基板を重ね れば Wolter I型望遠鏡として完成する。側壁は基板 に対して垂直な穴のため、理想曲面である回転放物 面と回転双曲面の円錐近似となるものの基板が薄い ため例えば300 μm 厚で焦点距離 250 mm といっ た短焦点でも近似の効果は約1秒角と極めて小さい。

本手法は穴幅を細かくできることから原理的に世 界最軽量であり、同時に従来1枚ずつ製作していた鏡 を一括して大量生産できるため低コストとなる。ま たエッチングと後工程を工夫することで、優れた角 度分解能も実現可能であり、最新の試作品で、Al Ka 1.49 keV の1回反射において部分照射であるが3分 角を達成している。Wolter I型の2回反射では5-10分 角程度と予想される。これは原理的には高温アニー ルの時間を延ばすことで、拡散長が時間の平方根に 比例して増え、鏡面が平坦化されるため改善すると 予想している。現在、10時間から50、100時間以上と アニール時間を徐々に延ばすことで平坦性が改善す ることを確かめられており、1分角を切る角度分解能 に挑戦している。最終目標は穴幅とX線波長から決 まる回折限界である13秒角(穴幅 20 µm、1 keV を 仮定)で、図1の矢印で示した性能となる。実現すれ ば、究極の超軽量X線望遠鏡となる。

なお、やや手前味噌になるが、この場を借りて宣伝 させて頂くと、我々は共同研究機関やメーカーの 方々とともに、ほぼインハウスで試作を進めて、試 作光学系でのX線反射・結像の実証[6]、ALD で膜 付けした Ir および Pt 膜付き光学系でのX線反射 実証[7]に世界で初めて成功してきた。さらに微細穴 X線光学系として知る限り世界最大の直径 300 mm (12 インチ)の試作とX線実証も行っており、製作評 価のノウハウを蓄積してきた。微細穴光学系の難点 は鏡の枚数が桁違いに多いことから、一部の鏡の形 状測定では全体の角度分解能が推定しづらいことに ある。そこで代表的な基板内の場所での側壁形状か らの角度分解能推定の手法や、変形した基板全体の 表面形状から内部の鏡の配置精度を見積もる手法を 確立して、評価に用いている[8]。

宇宙応用

我々の MEMS X線望遠鏡は開発途上ではあるが、 軽量性においては既に従来のあらゆる方式を約1桁 以上、上回っている。たとえば口径 4 inch Wolter I 型望遠鏡の重量は基板部分で約3g、支持するアルミ フレームを含めても約30gと非常に軽い。同時に基 板が薄く短焦点でも角度分解能の劣化が抑えられる ことから、X線観測装置の小型化に寄与する。そこで 今、我々が計画しているのが地球磁気圏を世界で初 めてX線で撮像する超小型衛星 GEO-X (GEOspace X-ray imager)である[9]。地球の周辺では太陽からの 高速イオン流である太陽風に含まれる多価イオン (炭素、窒素、酸素など)と地球の超高層大気であり

10地球半径(R_E)以上に広がる外圏に含まれる中性大

気(主に水素原子)の衝突によって電荷交換反応を生 じる。電子が足りない状態である多価イオンは中性 大気から電子を奪い、奪われた電子がイオン中で基 底状態に落ちる中でX線輝線を放射するのである。 この現象は1990年代にドイツの宇宙X線観測衛星 ROSATが全天サーベイ中に偶然発見し、2000年代 に入って日本の「すざく」衛星などの活躍によって



図3 地球近傍で生じていると考えられる太陽風電荷交換X線の描像およびX線空間分布シミュレーション[9]。地球磁気圏の衝撃波面の地球側で太陽風密度が高まるシース領域、地球の磁極に向かって磁場がす ぼむカスプ領域において強いX線発光が生じていると予想されている。

その描像が確立した、比較的最近になって分かって きた現象である。図3にその描像を示す。

このX線放射の空間分布は太陽風の電磁流体シミ ュレーションと地球外圏の密度モデルによって推定 することが可能である。仮に地球磁気圏の外で、月 付近(地球から約60R_E)から観測した場合、異方的な 分布を示すことが示唆されている(図3)。これは地球 から見て太陽側、いわゆる昼側の磁気圏の方が太陽 風の密度が高いことに起因する。太陽風フラックス はフレア等にともなって激しく時間変動するため、 この現象は宇宙X線観測にとっては雑音の把握の観 点で重要である。一方で、地球磁気圏観測にとって は昼側磁気圏境界面のイメージングという極めて大 きな意義を持つ。というのも、従来、地球磁気圏の これらの領域は、「その場」観測衛星と呼ばれる電 磁場粒子計測器を搭載した衛星を一機ないし複数機 飛ばして、点観測を繋ぐことで理解してきたのだが、 X線を使えば一気にその全体像を捉えることができ るためである。もちろん、「その場」観測ほどの高 い時間分解能や空間分解能は、遠地点からの撮像で は簡単ではないので、相補的と言える。

我々は「すざく」衛星を用いて太陽風電荷交換X線 を調べる中で、地球惑星科学の研究者の方々とこの 可能性に気が付いた。しかし、宇宙X線観測衛星は基 本的に地球の近傍を周回し、遠方天体を観測するた め、放射源の中からの観測となり、視野も限られる。 そこで我々はGEO-Xを発案した。放射源である地球 近傍を脱し、遠方から俯瞰的な観測を行うことでX 線による磁気圏撮像を実証しつつ、太陽風の変動に 伴うシースやカスプ、衝撃波や磁気圏界面の動圧変 化に伴う形状や移動を明確に捉えることを狙う。科 学目的を絞り込んだある種の実証的かつ挑戦的な衛 星であり、同時に太陽活動が上昇する2020年代前半 にタイムリーに打ち上げる必要があるため、近年、 発展著しい超小型衛星(50 kg 級, 50 cm 立方程度) での実現を目指している。

必要になるのが限られた衛星のスペースと重量、 電力の制約の下で、高感度を実現するための超小型 X線撮像分光装置であり、ここにMEMS X線望遠鏡 を搭載して、世界初の宇宙実証を目指している。図 4に示す。望遠鏡は MEMS Wolter I型で、口径 4 inch、焦点距離は 25 cm、視野 4 deg Φの軟X線 (0.3-2 keV) 用途である。目的とする太陽風電荷交換 反応は炭素や窒素、酸素のK輝線が主であるためエ ネルギーバンドは 2 keV 以下で十分である一方で、 20×10 deg 程度に広がると予想される昼側磁気圏



図4GEO-X 衛星と搭載する超小型X線撮像分光装置。

X線放射をカバーするために広い視野が必要となる。 角度分解能は構造が大きいため <10 分角で十分で あり、現在の性能で十分達成しうる。

広がったX線放射への感度指標として Grasp (有 効面積を視野内で積分した値)があるが、本装置の Grasp は「すざく」衛星に搭載したX線CCD+望遠 鏡に匹敵する。光軸方向に対する有効面積は100倍 程度小さいが、軟X線に特化して視野を大きく確保 できるためである。衛星は最速2022年頃にH3ロケ ットの相乗りでの打ち上げを目指しており、現在、 JAXA 宇宙科学研究所、東京大学、北海道大学、名 古屋大学、関東学院大学、関西学院大学らと開発を 進めている。なお、このような超小型X線撮像分光装 置は、地球周回の超小型衛星に搭載して、特定天体 (超巨大ブラックホールなど)の長時間観測を実現す るというような使い方[9]や、これまで装置の重量制 限で搭載が難しかった惑星探査機への応用[11]も考 えられ、さまざまな発展性を秘めていると考えてい る。こうした将来の発展性が認められ、MEMSX線 望遠鏡は 2019年 JAXA 宇宙科学技術ロードマッ プにて、「獲得すべきキー技術」に選出された。

派生的に生まれた新たな光学系

我々の MEMS X線望遠鏡は開発において様々な 技術を試してきており、結果としていくつかの派生 的な新しい光学系が生まれた。ここに紹介する。い ずれの手法も、X線反射あるいは結像に我々が世界 で初めて成功したものである。

(1)結晶異方性エッチングを用いた微細穴光学 系:ドライエッチングを用いる前に我々が開発して いた手法であり、Si 結晶面の KOH 等のアルカリ 溶液へのエッチングレートの違いを利用して、Si (110) 基板に滑らかな Si (111) 側壁を加工する手 法[12]。側壁は結晶面に沿うため平滑化が不要なほ ど表面粗さが低い(<1 nm rms)が、一方で結晶面に 沿った直線的な側壁となるため、ドライエッチング のような曲面穴が難しく、直線的な穴で曲面を近似 する必要がある。

(2) Focused Ion Beam を用いた微細穴光学系:微 小試料の断面観察などに用いられる Focused Ion Beam を微細穴加工に用いた光学系[13]。平滑な側 壁でかつ基板を傾けて加工することで斜めの穴も空 けることが可能だが、加工速度に課題がある。

(3) MEMS Lobster eye 光学系: MEMS Wolter I
 型X線望遠鏡の加工技術を用いて、四角の微細穴を
 形成して Lobster eye 光学系として用いる手法[14]。
 Wolter I型に比べて広い視野が容易に実現できるが、

集光像は原理的に十字に広がるため結像性能は Wolter I型の方が優れているため相補的と言える。

(4) Si 高温塑性変形鏡:MEMS X線望遠鏡で用い ている加工技術である Si 結晶の高温塑性変形を用 いて Si 基板そのものを全反射鏡として用いる手法 [15-16]。微細穴光学系ではなく、従来のフォイル方 式の Al 鏡を Si 鏡に置き換えたものだが、剛性が 高く平滑な Si 基板を母材に用いることで角度分解 能の大幅な向上が見込める。欧州が開発している SPO方式と似ているが、SPOは弾性変形を用いてお り、打ち上げ時の振動衝撃や温度変化による形状変 化が懸念される。我々の手法は塑性変形なのでその 心配がない。こうした独自性からMEMS X線望遠鏡 と同じく JAXA 宇宙科学技術ロードマップにて「獲 得すべきキー技術」に選出された。

この他にも我々はSi 高温塑性変形を利用した新し い集光可能なブラッグ反射型X線偏光計、MEMS Wolter I型の中性子望遠鏡など新しい光学系を考え て開発しており、さまざまな宇宙観測や地上の放射 線計測に応用できればと思っている。

謝辞

本研究は東京都立大、JAXA 宇宙科学研究所、産業 技術総合研究所、東北大学、京都大学、九州大学、 東京大学、立命館大学、宇都宮大学、フロリダ大 学、国立天文台およびメーカーの方々の共同研究に よる。また JSPS 科研費 20684006、23684009、 26287032、18K18775、20H00177、JAXA 宇宙科 学研究所 搭載機器基礎開発実験費、戦略的開発研 究経費、稲森研究助成、東レ科学研究助成、首都大 学 若手奨励経費、傾斜的研究費の助成を受けた。

References

[1] M. Bavdaz et al., X-Ray Pore OpticsTechnologies and Their Application in SpaceTelescopes, X-ray Opt. and Instrum., 295095(2010).

[2] M. Bavdaz, Silicon Pore Optics: modular high performance X-ray optics, X線結像光学ニューズレ ター, No.50, 1, (2019).

[3] Y. Ezoe et al., Ultra light-weight and highresolution X-ray mirrors using DRIE and X-ray LIGA techniques for space X-ray telescopes, 16, 1633 (2010).

[4] K. Nakajima et al., Shaped silicon-crystal wafers obtained by plastic deformation and their application to silicon-crystal lenses, Nature Materials, 4, 47 (2005).

[5] D. Ishi et al., Enhanced X-ray reflectivity fromPt-coated silicon micropore optics prepared byplasma atomic layer deposition, Appl. Phys. Express,13, 0870001 (2020).

[6] Y. Ezoe, et al., Large aperture focusing of x rays with micropore optics using dry etching of silicon wafers, Optics Letters, 37, 779 (2012).

[7] T. Ogawa, et al., Iridium-coated micropore X-ray optics using dry etching of a silicon wafer and atomic layer deposition, Applied Optics, 52, 5949 (2013).
[8] M. Numazawa, et al., Evaluation of arrangement error of micropore X-ray optic due to hot plastic deformation process, J. Japan Appl. Phys., 57, 06HJ11 (2018).

[9] Y. Ezoe, et al., Ultra light-weight X-ray telescope missions : ORBIS and GEO-X, J. Astron. Telescope Instrum., 4, 046001 (2018).

江副, 地球磁気圏外からのX線観測 GEO-X-X線天 文と深宇宙探査の融合, 天文月報, 7, 444 (2018).

[10] I.P. Robertson et al., X-ray emission from the terrestrial magnetosheath including the cusps, J. Geophys. Res., 111, A12105 (2006).

[11] Y. Ezoe et al., JUXTA : a new probe of X-ray emission from Jupiter, Advances in Space Res., 51, 1605 (2013)

[12] Y. Ezoe et al., Micropore x-ray optics using anisotropic wet etching of (110) silicon wafers, Applied Optics, 45, 8932 (2006). [13] M. Numazawa et al., First demonstration of X-ray mirrors using focused ion beam, J. Japan Appl.
Phys., 55, 06GP11 (2016).
[14] R. Otsubo et al., First demonstration of Lobster eye X-ray optics fabricated with Deep Reactive Ion Etching, International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2019), 31D-9-1

(2019).

[15] Y. Ezoe et al., Shaped Silicon Wafers Obtained by Hot Plastic Deformation : PerformanceEvaluation for Future Astronomical X-rayTelescopes, Appl. Opt., 48, 3830 (2009).

埋め込み X 線ターゲットを用いた高感度・高分解能透過型 X 線イメージング

大阪大学大学院工学研究科

志村 考功

1. はじめに

透過型X線撮像装置は物質の内部を非破壊で観察 できることから様々な分野で活用されている。近 年、医療分野では核磁気共鳴や超音波等による非破 壊診断法の格段の進歩があったが、依然としてレン トゲン検査に代表されるX線診断は、健康診断か ら精密検査の各レベルの診断で重要な役割を果たし ている。また、最近では製品の安全、安心、信頼性 への関心が非常に高まっており、製造者、販売者に 対する責任も以前にも増して問われるようになって いる。そのため、透過型X線撮像装置の生産現場や 納入、出荷時における非破壊検査用機器としての需 要が増している。特に食品や飲料品、乳幼児向け製 品は抜き取り検査から全数検査へと進展すると考え られる。さらに、空港での携行品のセキュリティチ エック、税関での麻薬などの違法物検査などもその 精度の向上が求められている。安全・安心な社会の 実現のためには、医療用としては低被爆線量と高精 度診断の両立、非破壊検査装置としては検査精度の 向上と低コスト化を両立し、多様な要求に答えてい く必要がある。

ここでは我々が独自に検討を進めてきた埋め込み X線ターゲットを用いた透過型X線撮像法につい て報告する。

2. 埋め込み X 線ターゲット

実験室系X線装置の光源はターゲット金属に電子 線を照射することによりX線を発生する。ターゲッ ト金属の熱負荷を低減するためにターゲット金属を 回転したり、光源サイズを小さくするために照射す る電子線を集光するなどの技術開発はあったものの その様態は数十年以上ほとんど変わっていない。一 方、我々はダイヤモンド基板にターゲット金属を埋 め込んだ埋め込みX線ターゲットを検討してきた



図1 埋め込み X 線ターゲット

(図1)。このターゲットを用いた場合、実効的な 光源形状は照射する電子線の照射形状によらず、埋 め込んだターゲット金属形状できまる。通常、電子 線のターゲット金属への侵入長は数µm であるた め、高アスペクト比の構造を用いないでターゲット 金属の形状をµm のスケールで自由にデザインでき る。ダイヤモンドは通常、ターゲット金属として用 いられる銅、モリブデン、タングステン等と比べ て、耐熱性では同等、熱伝導率は遥かに高い値を示 す。これは電子線照射によるターゲット材の昇華を 防ぐことができ、熱負荷で制限されていた励起電子 線パワーを従来以上に増加させることができること を意味する。一方、希土類金属(ランタノイド)の ような熱伝導率が低く、従来ターゲット材として用 いることができなかった材料もダイヤモンド基板に 埋め込むことによりターゲットとして用いることが 可能になる。

3. X線タルボ・ロー干渉計への適用

透過型 X 線格子を 3 枚用いるタルボ・ロー干渉 計は、空間的可干渉性に乏しい、光源サイズの大き い X 線源を用いても X 線位相及び小角散乱イメー ジングを可能にする手法として注目されている(図 2a)[1,2]。回折格子(G₁)の直前に試料を配置した場 合、試料内部の位相シフトによって X 線が屈折 し、それに伴い自己像(G₁の干渉像)がわずかに変



図 2 (a)タルボ・ロー干渉計 (b-d) 埋め込み X 線ターゲットを適用した光学系.

形する。また、小角散乱によって自己像のビジビリ ティが低下する。変形した自己像の位置に吸収格子 (G₂)を重ね合わせることで、自己像の変形をモアレ 縞として検出している。光源格子(G₀)をこれらの格 子と光源の間に配置することにより、サイズの大き な光源でもX線位相イメージングを可能にしてい る。

光源格子(G₀)、吸収格子(G₂)は多数の微細な開口 部(数μm幅)を有する一方で、非開口部で透過力の 高いX線を遮蔽しなければならず(~50 μm厚) 、 高アスペクト比の構造が必要(高コスト、視野制 限)である。

我々は埋め込みX線ターゲットを適用すること により光源格子(G₀)を用いない光学系を実証し た(図2b)。マルチライン状に金属を配置した埋 め込みX線ターゲットにより、タルボ・ロー干渉 計における光源と光源格子を置き換えた。埋め込み 金属の厚さは励起電子線の吸収に必要な厚さ(数μ m程度)でよいので、個々の金属ラインの幅を容 易に狭くすることができ(図3a)、タルボ・ロー干 渉計の全長の短縮及び撮影時間を低減できることを示した[3]。8 keV の X 線を用いれば光源から G₂ までの距離をわずか 40 cm まで短縮することができるため、1.2 W (20 kV, 0.06 mA)の極端に低い投入電力でも良好な像を得ることができた(図 3b)。 さらに埋め込みターゲットのライン幅を 1 µm 以



図3(a) 埋め込み X 線ターゲット(b) アクリ ル球の微分位相像

下に細くすることにより(図 4a) 、吸収格子も除い た自己像直接検出型の光学系を実現した(図 2c) 。 通常、吸収格子を検出器直前に配置し、位相格子の 自己像とのモアレを2次元検出器で検出する。これ は自己像の周期が検出器の画素サイズよりも小さ く、自己像を直接測定できないことによる。狭い線 幅の埋め込みターゲットを用い、位相格子と光源の 距離を数 cm と短縮することにより、全長1mの光 学系での自己像直接検出光学系を実証した[4]。試 料による自己像の変形やビジビリティの減少を直



図 4 (a) 埋め込み X 線ターゲット (b) アクリル 球の測定画像 (c) 微分位相像 (d) 小角散乱像.

接、画像として検出するため(図 4b)、1ショット での撮影が可能となる。タルボ・ロー干渉計では吸 収格子を走査しながら測定した複数枚の画像を用い て解析が行われることが多いが、1ショットでの測 定は測定時間の短縮、被ばく線量の低減につなが る。ポリスチレン球の空洞、米粒内のクラックが位 相微分像や小角散乱像で鮮明に観測されていること を確認できる(図 4c,d)。

光源格子や吸収格子を用いる通常のタルボ・ロー 干渉計でも2次元化は可能だが、画像取得手順が複 雑になり、2次元格子によるX線強度の減衰も著し い。一方、自己像直接検出型の光学系では比較的容 易に2次元化が可能である(図2d)。埋め込みX線 ターゲットの金属をドット状に配置し(図5a)、位 相格子をチェッカーボード状にすれば(図5b)、2 次元ドット状の自己像を形成できる(図2c)。この



図5(a) マルチドット状埋め込みターゲット (b) チェッカーボード状位相格子(c) アクリル 球での取得画像とマルチドット状の自己像(d) 左右方向の位相微分像(e)上下方向の位相微分 像(f)左右方向の小角散乱像(g)上下方向の 小角散乱像

2次元ドット状の自己像のドットの変位量やビジビ リティを直接計測することで2次元の微分位相像や 小角散乱像を1ショットで取得することができる [5,6]。米粒内のクラックは左右方向の小角散乱像 では確認することが困難だが(図 5f)、上下方向の像 では明瞭に観察されており(図 5g)、その有用性を 示している。

3. 超解像X線イメージング

透過型X線撮像装置は電子線を金属ターゲットに 照射することによりX線を発生し、試料(被写体)を 透過したX線を2次元検出器で検出する。このとき 像の空間分解能は光源サイズと2次元検出器の分解 能で決まる。通常、X線の検出器のピクセルサイズ は数十µmと大きいため、数µmの空間分解能を得 るためには微小X線光源が必須である。一方で電子 線を集光し光源サイズを小さくすると比例して投入 電力も小さくしなければならず、空間分解能とX線 強度のトレードオフはX線撮像装置の本質的課題と して甘受されてきた。

一般に画像計測により得られる像は被写体からの 実像に測定系に依存する関数(PSF: Point Spread Function)を畳み込み積分(Convolution)した像とし て得られる。PSFを何らかの方法により推定し、ボ ケのない元画像を得ようとする試みはあるものの、 通常は、PSFが正確に得られないことや観察画像に ノイズが含まれることから元画像の再構築は困難な ものとなっている。

埋め込みターゲットを用いると多数の微細な金属 ターゲットを正確に設計通りに配置することが可能 となる。この場合、金属ターゲットの位置は正確に 求められるので、その位置情報から再構築すると、 元画像は得られないものの、再構築された像は微細 な金属ターゲット1個で撮影した像と同じ解像度を 有することになる(図6)[7]。

図6の場合、5×5個の金属ターゲットに電子線を 照射することになるが、再構築された像は電子線照 射領域の10分の1の大きさの光源で得られる像と



図6 埋め込み X 線ターゲットを用いた超解像技術.

同等の解像度となる。この手法により高分解能と測 定時間の短縮を同時に達成することが可能となる。

ひとつの光源で得られる画像を f(x)とすると、マ ルチ光源で得られる画像 g(x)は a₁, a₂, ..., a_N を各光 源ごとの画像のシフト量として

g(x)=f(x-a₁)+f(x-a₂)+···+f(x-a_N) と表される。そのフーリエ変換 F[g(x)](k)は

F[g(x)](k)=(e^{ika1}+e^{ika2}+···+e^{ikaN})F[f(x)](k) となり、光源の位置情報から逆フーリエ変換によ り、

 $f(x) = F^{-1}[F[g(x)](k)/(e^{ika1}+e^{ika2}+...+e^{ikaN})](x)$ が得られる。光源の位置が図6のように完全に周期 的だと $(e^{ika1}+e^{ika2}+...+e^{ikaN})$ の項がある周波数のとき に0になる。これはその周波数成分の画像情報が欠 落することを意味し、また、再構成の数値処理時の 障害となるので、光源の配置の並進周期性はない方 がよい。5角形状に配置した埋め込みターゲットを 用いてX線チャートを測定したところ(図7b)、0.6 µm ピッチのパターンの像を得ることができた(図 7c)。

一つの光源サイズが直径 1 μm にもかかわらず、 光源サイズよりも小さい 0.6 μm ピッチのパターン の像が得られたのは埋め込み X 線ターゲットの光 源形状の鮮明さによる。薄膜状の金属ターゲットに



図7(a)測定光学系(b)埋め込みX線ターゲットと電子線照射領域(c)X線チャートの測定結果.

電子線を集光して照射した場合、光源の強度分布は 中央部から離れるにしたがって徐々に減衰する正規 分布状になる。一方、埋め込みX線ターゲットで は金属とダイヤモンドの境界で急峻に減衰する。こ れらの強度分布をフーリエ変換すると急峻な境界を もつ埋め込みターゲットの方が強い高周波成分を有 することになる。このため、直径1µmの光源サイ ズでも 0.6µm ピッチのパターンの像を得ることが できた。

ここで報告したタルボ・ロー干渉計関連の研究成 果は森本直樹博士(現 島津製作所)が在学中に中心 になって進めたものであり、学位論文にまとめられ ている。また、本研究は、原田仁平先生(名古屋大 学名誉教授)、大嶋健一先生(筑波大学名誉教授) をはじめ、大阪大学工学研究科 渡部平司研究室の 学生を含む多くの協力者によって進められた。本研 究で用いた埋め込みX線ターゲットや位相格子は 一部を除き、学内の施設で学生が作製したものであ り、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム 事業(課題番号 JPMXP09F10OS0038, JPMXP09F19S0015, JPMXP09F16OS0015, JPMXP09F17OS0008, JPMXP09F16OS0002)の 支援を受けた。また本研究は、JST 先端計測プログ ラム、科研費(18K18752, 16H00948, 15K13408)の 支援を受けた。

参考文献

- [1] F. Pfeiffer et al., Nature Phys. 2, 258 (2006).
- [2] F. Pfeiffer *et al.*, Nature Mater. **7**, 134 (2008).
- [3] T. Shimura *et al.*, Opt. Lett. **38**, 157 (2013).
- [4] N. Morimoto et al., Opt. Lett. 39, 4297 (2014).

[5] N. Morimoto *et al.*, Opt. Express **23**, 16582(2015).

[6] N. Morimoto *et al.*, Opt. Express **23**, 29399(2015).

[7] 特許第 6256941 号



原稿をご提供いただいた、江副先生、志村先生に感謝いたします。今年は COVID-19 の影響で、国際 会議が軒並み中止・延期になってしまいました。特に、横浜で6月に開催予定であった宇宙観測用光 学系・検出器の主要な国際学会である、SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation が、2020 年 12月にオンライン開催になってしまいました。このため、今号ではやむを得ず国際会議報告の掲載を あきらめざるをえませんでした。ご容赦ください。次号が出る頃には COVID-19 の猛威も収まり、通 常通りのニューズレターが発行できることを願っております。編集部一同、読者のみなさまのご健康 を願っております。今後ともよろしくお願いいたします。

(文責・松本浩典)

【メーリングリスト(登録メールアドレスの変更などについて)】

本ニューズレターは原則、メーリングリスト(xio-nl@prec.eng.osaka-u.ac.jp)によるメール配信となっております。メールアドレス変更などの際には、お手数ですが、編集部(xioedit@prec.eng.osaka-u.ac.jp)までご連絡ください。メーリングリストは、研究会のお知らせなど、会員全員に情報を配信したいときなどにも便利なので、積極的にご活用ください。

X線結像光学ニューズレター No. 52 (2020 年 12 月) 発行 X線結像光学研究会 (代表 兵庫県立大 篭島靖)
 編集部 山内和人(大阪大)、齋藤彰(大阪大)、矢代航(東北大)、 高野 秀和(東北大)、松本浩典(大阪大)、 東口武史(宇都宮大)、 E-mail: xioedit@prec.eng.osaka-u.ac.jp